

田修波

理学博士

先进焊接与连接国家重点实验室 副主任

教授\博士生导师

+86-451-86418791

xiubotian@hit.edu.cn

xiubotian@163.com

主要研究方向

难焊材料表面改性焊接新技术与方法
等离子体-电子束加热、焊接新技术与方法
等离子体离子注入-沉积表面改性技术与方法
薄膜沉积与功能涂层制备技术与方法
高功率脉冲磁控溅射电源与放电技术
等离子体放电及鞘层控制理论
脉冲高压电源及等离子体表面处理设备

社会兼职

先进焊接与连接国家重点实验室 副主任；
离子束表面改性国际学术委员会（SMMIB）委员；
中国真空学会 常务理事；
中国真空学会表面工程与冶金专委会 副主任；
中国机械工程学会表面工程专委会 常务委员；
中国力学学会等离子体专委会 委员；
中国真空学会薄膜专委会 委员；
美国 IEEE Plasma Sci 2009 年特刊、2010 年度特刊 Guest editor
真空杂志 编委；
真空科学与技术学报 编委；
2006 年度国家自然科学基金数理学部 特邀评委委员；
第十一届等离子体离子注入/沉积国际会议（PBIID）会议主席；
第十七届离子束表面改性国际会议（SMMIB）会议主席；
第三届 IEEE 纳电子国际会议 Nano-Physics 主题程序委员会主席。

主要学术成果

发表 SCI 检索论文 100 余篇，发明专利 20 余项，主持自然科学基金项目 4 项，主持总装项目 2 项，参与 973 项目 1 项。研制的设备输出到香港、新加坡、土耳其、印度等等。

1. 张欣盟； 田修波； 巩春志； 杨士勤，约束阴极微弧氧化放电特性研究，物理学报，2010, 8
2. Tian XB, Jiang HF, Gong CZ, Yang SQ, DLC deposition inside tubes using hollow cathode discharge plasma immersion ion implantation, Surface and Coatings Technology, 2010, 204: 2909-2912
3. Tian XB, Gong CZ, Huang YX, Yang SQ, Theoretical investigation of plasma immersion ion implantation of cylindrical bore using hollow cathode plasma discharge, Surface and Coatings Technology, 2009, 203: 2727-2730
4. Tian XB, Gong CZ, Huang YX, Yang SQ, Ion trajectories in plasma ion implantation of slender cylindrical bores using a small inner end source, Applied Physics Letters, 2008, 93, 191501
5. Gong CZ, Tian XB, Yang SQ, Chu Paul K, Direct coupling of pulsed radio frequency and pulsed high power in novel pulsed power system for plasma immersion ion implantation, Review of Scientific Instruments, 2008, 79:043501